19日本国特許庁

①特許出願公告

許 公 特

昭53—13223

61 Int.Cl.2

識別記号 図日本分類

庁内整理番号 ❷公告 昭和53年(1978) 5 月 9 日

C 08 L 101/00 B 05 D 5/12 C 08 F 220/34 C 09 K 3/16 25(1) A 251.21 13(9) B 31 26(3) C 162·11 25(5) K 111.5

7144 - 486917 —4 A 7455 —45 6365 - 47

発明の数

(全 12 頁)

1

図帯電防止されたハロゲン化銀写真感光材料用プ ラスチック支持体フイルム

願 昭48-110994 ②)特

顧 昭48(1973)10月4日 22出 (前置審査に係属中)

開 昭50-94053 公

函昭50(1975)7月26日

70発明者、小宮衛

日野市さくら町 1小西六写真工業 10

株式会社内

永安浩一 同

同所

間山正義 同

同所

寺田定次 同

同所

创出 願 人 小西六写真工業株式会社

東京都中央区日本橋室町3の1の

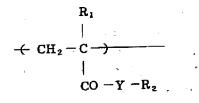
10

何代 理 人 桑原義美

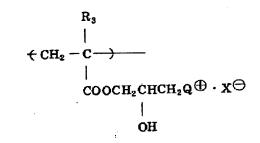
匈特許請求の範囲

分子構造中に下記一般式〔Ⅰ〕で示される構 される構造単位を少なくとも一種とを含む共重合 体を含有する層を有することを特徴とする帯電防 止されたハロゲン化銀写真感光材料用ブラスチツ ク支持体フイルム。

一般式〔1〕



一般式〔II〕



2

〔上記各式中、R₁およびR₂は水素原子またはメ チル基、Rは置換基を有してもよい炭素原子数が 4以上のアルキル基、置換基を有してもよいアラ ルキル基、置換基を有してもよいアリール基を表 15 わす。 Yは酸素原子または>N-R, を表わし、 R4 は水素原子もしくはアルキル基を表わす。

20 R₅ はアルキル基、フェニル基、ベンジル基もし くはアミノ基、Ro、Roは低級アルキル基を表わ す。ただし Rs が低級アルキル基のときは Rs と R₇ は互に連結して含窒素 5~ 6 員複素環を形成 してもよい。2は含窒素5~6員複素環を形成す 造単位を少なくとも一種と下記一般式〔Ⅱ〕で示 25 るに必要な炭素原子、窒素原子または硫黄原子か ら選ばれる非金属原子群を表わし、X⊖はアニオ ンを表わす。〕

発明の詳細な説明

本発明は優れた持続的帯電防止効果を附与され 30 たプラスチツク材料に関するものである。一般に プラスチツク材料は磨擦及び剝離等により静電気 を帯びやすく、このため種々の障害を発生するこ とは良く知られている。例えば塵埃が付着し易い とか、放電電撃により人体にショックを与えると 35 か、可燃性ガスが存在する場合には引火して爆発 を誘発するなどの障害を発生することが知られて いる。又例えばプラスチツクフイルムの製造工程

中においても加工不良や巻取不良などの故障の原 因となる。特にハロゲン化銀写真感光層を設層し た複合プラスチック材料においては放電により所 謂スタチックマークを生じ、これはハロゲン化銀 写真感光材料にとつて致命的な障害となる。

従来とれらのプラスチック材料の帯電により障 害を除くため、各種の帯電防止加工方法が多数提 案されている。例えば導電性低分子界面活性剤あ るいは導電性高分子電解質をプラスチック材料に 含有せしめプラスチック材料表面に電気伝導性を 10 賦与して電荷の蓋積を防ぐ方法がある。 しかしな がら、これらの低分子界面活性剤または導電性高 分子電解質は皮膜の強度が小さく、しかも水溶性 であるから、このような帯電防止剤を含有せしめ たプラスチック材料は帯電防止剤が付着、転写ま 15 たは水に溶解派出して帯電防止効果が減少または 消失してしまい、持続的帯電防止効果を付与する ことが不可能になる。又従来の帯電防止剤は湿度 による抵抗値の変化が大きく従つて安定した帯電 5 に湿度に影響されにくく、他物に付着、転写す ることがなく、さらに水に不溶性にして充分に持 続的な帯電防止効果を発揮しうるプラスチツク材 料用の帯電防止剤は未だ見出されていないのが実 情である。

本発明の目的はこのような欠点のない帯電防止 剤を提供するとともに、その帯電防止剤を用いて 種々のプラスチック材料、例えばプラスチックフ イルム、プラスチックシート、グラブイックアー ト用材料、プラスチック成型品等に静電障害のな 30 してもよい。 Zは含窒素 5 ~ 6 員複素環を形成す い、特にプラスチックフィルム上にハロゲン化銀 写真感光層を積層した複合プラスチツク材料にお いて塵埃の附着による障害及び放電による所謂ス タチツクマーク等の障害を発生することのない持続 的に帯電防止効果を有するプラスチック材料を提 35 る疎水性構造単位と前記一般式〔Ⅱ〕で示される 供することにある。

該目的は、分子構造中に下記一般式〔Ⅰ〕で示 される構造単位を少なくとも一種と下記一般式 【Ⅱ】で示される構造単位を少なくとも一種とを 含む共重合体を含有する層をプラスチック材料上 40 実質的に水不溶性にすることができる。したがつ に設層することにより達成される。

一般式〔Ⅰ〕

$$\begin{array}{c|c}
R_1 \\
| \\
CH_2 - C \longrightarrow \longrightarrow \\
| \\
CO - Y - R_2
\end{array}$$

一般式〔II〕

〔上記各式中、R,及びR。は水素原子またはメチ ル基、R。は置換基を有してもよい炭素原子数が 4以上のアルキル基、置換基を有してもよいアラ 防止効果が得られないという欠点がある。このよ 20 ルキル基、置換基を有してもよいアリール基を表 わす。Yは酸素原子または N-R4 を表わし、 Raは水素原子もしくはアルキル基を表わす。

$$Q$$
 \oplus は $-$ N $=$ R₆ または $-$ N $=$ Zを表わし、 R_7

Rs はアルキル基、フエニル基、ペンジル基もし くはアミノ基、R6、R7は低級アルキル基を表わ す。ただしR。が低級アルキル基のときはR。と R7 は互に連結して含窒素 5~6員複素環を形成 るに必要な炭素原子、窒素原子または硫黄原子か ら選ばれる非金属原子群を表わし、X⊖はアニオ ンを表わす。〕

即も本発明における前記一般式〔Ⅰ〕で示され 親水性第4級アンモニユウム塩を有する構造単位 とを含有する共重合体を帯電防止層として用いる ことにより、着しく水溶性が減少し、特に疎水性 構造単位の共重合比及び種類をかえることにより てこのような共重合体を含む層を有するプラスチ ツク材料は水洗処理をした後にも充分な帯電防止 効果を持続することができる。またとくに本発明 の帯電防止されたプラスチック材料上にハロゲン

化銀写真感光層を設層した感光材料においては、 画像露光後アルカリ性現像液及び酸性定着液等に より処理した場合でも帯電防止効果を失うことは なく、画像表面に塵埃の付着を防止することがで きる。 このような帯電防止効果を発揮しうる材料 5 -OC18 H₃₃、-OC18 H₃₇、-OCH₂ として各種の疎水性構成単位と親水性第4級アン モニウム塩を含む構成単位との組合せから作られ る共重合体のなかで本発明の一般式(『うで示さ れるアグリル酸又はメタクリル酸のエステルもし くはアミドと一般式(II)で示されるアクリル酸 10 -OC。HoOH、-OC。HoBr2、 またはメタクリル酸の2ーヒドロキシブロビルエ ステルの第4級アンモニウム塩を共重合体の構成 単位として含むものが特に優れた効果を発揮する ものである。当該共重合体において前記疎水性構 成単位の重合成分を増加するととにより水に対す 15 - OCH₂ CH₂ CH(OCH₃) CH₅、 る溶解性を減少せしめることができる。

また前記疎水性構成単位のエステル基に炭素数 のよい多い基を導入することによりプラスチツク 材料の摩擦係数を制御することができ、特にハロ ゲン化銀写真感光材料の帯電防止層として用いた 20 とき、撮影時のカメラ内でのフイルム送りが円滑 になるなどの利点を有することもできる。また本 発明の共重合体は必要に応じて前記一般式〔Ⅰ〕 及び一般式〔1〕で示される構造単位に加えて他 の構成単位、例えばスチレン、醋酸ビニル、塩化 25 ビニリデンまたはアクリロニトリル等を重合成分 として含有するものであつてもよい。 このような 他の構成単位を本発明の構成単位と共に共重合せ しめる場合の共重合モル比は30%以下が好まし い。さらにまたプラスチック材料上に前記本発明 30 の共重合体のみを設層してもよいし、他の高分子 化合物と混合して設層してもよい。

本発明の共重合体における前記一般式〔Ⅰ〕で 示される構造単位の代表的具体例としては次のも のを挙げることができる。即ち

一般式〔I〕

$$\begin{array}{c|c}
R_1 \\
| \\
CH_2 - C \longrightarrow \\
| \\
CO - Y - R_2
\end{array}$$

R₁ は水素原子またはメチル基であり、

-Y-R2M-OC3 H7, -OC4 H9, -OC5H11,

 $-OC_{8}H_{17}, -OC_{12}H_{25}, -OC_{14}H_{29},$

$$5 - OC_{16} H_{33}, -OC_{18} H_{37}, -OCH_{2}$$

-OCH₂CH₂N(CH₃)₂, <math>-OCH₂CH₂N(C₂H₅)₂

 $-OCH_2CH-CH_2$, $-O(CF_2CF_2)_2H$,

-NHC(CH₃)₂ CH₂ C(CH₃)₃ 又は

-NHCH₂OC₄H₀ で示される構造単位。

また本発明の共重合体における前記一般式〔 11〕 で示される構造単位の代表的具体例としては次の ものを挙げることができる。 即ち

一般式〔Ⅱ〕

において、

Raは水素原子またはメチル基であり、

 $35 - Q \oplus X \ominus (1 - N \oplus (CH_3), C1 \ominus)$

 $-N \oplus (CH_3) (C_2H_5)_2 \cdot C1 \ominus$

 $-N \oplus (CH_3)_3 \cdot Br \ominus (-N \oplus (C_2H_5)_3 \cdot C_1 \ominus ($

 $-N \oplus (C_2 H_5)_3 \cdot B_r \ominus$

 $-N \oplus (CH_3) (C_2 H_5)_2 \cdot Br \ominus$

 $40 - N \oplus (C_3 H_7) (C_{12} H_{25}) (C_2 H_4 O H) \cdot C I \ominus$

$$-N^{\bigoplus}(C_2H_5)_3\cdot CH_3$$
 $-SO_3^{\bigoplus}$

において、

$$\begin{array}{c|c} CH_3 \\ + CH_2 - CH \xrightarrow{}_m & (CH_2 - C \xrightarrow{})_n \\ & | \\ COOCC_4 H_9 & COOCH_2 CHCH_2 N \oplus (CH_3)_3 \cdot C1 \ominus \\ & | \\ OH \end{array}$$

 $\vec{M} = 100$, m: n=50:50

(2) (1)と同じ構造単位を有し、M÷100、m: n=10:90の共重合体。 n=30:70の共重合体。 (4)

(3) (1)と同じ構造単位を有し、M÷100、m:

*-N-CH₂ CH₂ OH · C₁ O

で表わされる構造単位。

このような一般式(I)及び一般式(I)で示される構造単位を有する共重合体を合成するには これらの構造単位を有する単量体を有機溶剤に溶 10 解し重合剤、例えばアゾビスイソプチロニトリル 等を加えて従来公知の方法により加熱重合すれば よい。

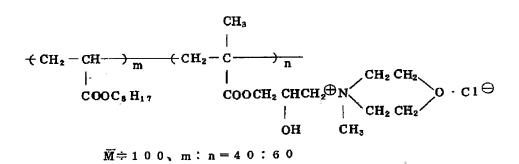
次に前記一般式[I]及び一般式[I]で示される構造単位を重合成分として含有する共重合体 15 の代表的具体例を列挙する。なお構造式中Mは平均重合度、m:n:lは各構造単位の重合モル比を表わす。

--

 $\overline{M} = 100$, m: n=50:50

(5)

(6)



(7)

$$\begin{array}{c} CH_{3} \\ | \\ | \\ CH_{2}-CH \xrightarrow{}_{m} (-CH_{2}-C \xrightarrow{}_{n})_{n} \\ | \\ | \\ COOC_{14}H_{29} & COOCH_{2} CHCH_{2} N \oplus (C_{2}H_{5})_{3} \cdot CH_{3} & SO_{3} \\ | \\ | \\ OH \\ \hline M = 1 \ 2 \ 0 \ , \ m : n = 3 \ 0 : 7 \ 0 \\ | \\ | \\ -139- \end{array}$$

12

(8)

$$CH_{3}$$

$$(CH_{2}-CH) \xrightarrow{m} (CH_{2}-C) \xrightarrow{n}$$

$$(CH_{2}-CH) \xrightarrow{m} (CH_{2}-CH) \xrightarrow{n} (COOCH_{2} CHCH_{2} N \oplus (C_{2}H_{5})_{3} \cdot CH_{3}) \xrightarrow{N} (CH_{3}-CH) \xrightarrow{N} (COOCH_{2} CHCH_{2} N \oplus (C_{2}H_{5})_{3} \cdot CH_{3}) \xrightarrow{N} (CH_{3}-CH) \xrightarrow{N} (COOCH_{2} CHCH_{2} N \oplus (C_{2}H_{5})_{3} \cdot CH_{3}) \xrightarrow{N} (CH_{3}-CH) \xrightarrow{N} (COOCH_{2} CHCH_{2} N \oplus (C_{2}H_{5})_{3} \cdot CH_{3}) \xrightarrow{N} (CH_{3}-CH) \xrightarrow{N} (COOCH_{2} CHCH_{2} N \oplus (C_{2}H_{5})_{3} \cdot CH_{3}) \xrightarrow{N} (CH_{3}-CH) \xrightarrow{N} (COOCH_{2} CHCH_{2} N \oplus (C_{2}H_{5})_{3} \cdot CH_{3}) \xrightarrow{N} (CH_{3}-CH) \xrightarrow{N} (COOCH_{2} CHCH_{2} N \oplus (C_{2}H_{5})_{3} \cdot CH_{3}) \xrightarrow{N} (CH_{3}-CH) \xrightarrow{N} (COOCH_{2} CHCH_{2} N \oplus (C_{2}H_{5})_{3} \cdot CH_{3}) \xrightarrow{N} (CH_{3}-CH) \xrightarrow{N} (COOCH_{2} CHCH_{2} N \oplus (C_{2}H_{5})_{3} \cdot CH) \xrightarrow{N} (CH_{3}-CH) \xrightarrow{N} (COOCH_{2} CHCH_{2} N \oplus (C_{2}H_{5})_{3} \cdot CH) \xrightarrow{N} (CH_{3}-CH) \xrightarrow{N} (CH_{3}-CH) \xrightarrow{N} (COOCH_{2} CHCH_{2} N \oplus (CO$$

(9)

$$CH_3$$

$$CH_2-CH \xrightarrow{m} CH_2-C \xrightarrow{n}$$

$$COOC_{18}H_{37} COOCH_2 CHCH_2 N \oplus (C_2H_5)_3 \cdot CH_3 \longrightarrow SO_3 \ominus$$

$$OH$$

$$\overline{M} \rightleftharpoons 1 2 0, m : n = 3 0 : 7 0$$

40

$$CH_{3}$$

$$CH_{2}-C \xrightarrow{m} (CH_{2}-CH \xrightarrow{n} n$$

$$COOC_{2} H_{4} N(C_{2} H_{5})_{2} COOCH_{2} CH \xrightarrow{N} S \cdot C1 \Theta$$

$$CH CH_{3}$$

$$\overline{M} \stackrel{.}{=} 50, m: n=50:50$$

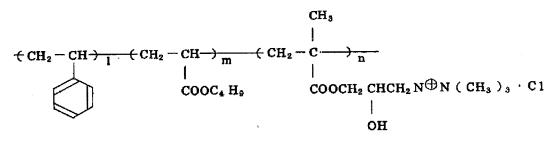
(11)

$$\begin{array}{c|c} CH_3 \\ + CH_2 - C \xrightarrow{\hspace{1cm} m \hspace{1cm}} - CH_2 - CH \xrightarrow{\hspace{1cm} n \hspace{1cm}} \\ | \\ COOCH_2 CH - CH_2 & COOCH_2 CH - N \\ \hline \\ OH & CH_3 \end{array} \\ \cdot C1 \ominus$$

$$\overline{M} = 50$$
, m: n = 50: 50
-140-

14

(12)



 $\vec{M} \neq 1 \ 2 \ 0$, 1:m:n=20:40:40

(13)

 $\overline{M} = 1 \ 20, \ 1:m:n=30:40:30$

(14)

 $\overline{M} = 1 \ 0 \ 0 \ 1 \ : m : n = 1 \ 0 \ : 5 \ 0 \ : 4 \ 0$

以下に本発明に係わる共重合体の代表的合成例 を示す。 合成例 1

例示化合物(1)の合成

グリシジルメタアクリレート142**9**(1モル) とトリメチルアミン塩酸塩96**8**(1モル)とハ

イドロキノン 0.1 **9**を 2 4 **9**のペンジルアルコー 40 ル中に溶解し、攪拌下に 6 0 c で 7 0 分間反応せ しめた。この反応液をアセトン中に注加して結晶 沈澱物を得た。これを沪取し、さらに再結晶して 次の単量体 C1

CH₅

$$|CH_2 = C$$

$$|COOCH_2 CHCH_2 N^{\bigoplus} (CH_3)_8 \cdot C1^{\bigoplus}$$

$$|CH_3 \cap CHCH_3 \cap CHCH_$$

150分を得た。

C

融点183℃ 元素分析

計算値 50.60 5.90 1 4.9 3 8.48 5.75 15.28 分析値 49.14 8.60 得られた単量体 2 3.8 g (0.1モル) と、 n ー プチルアクリレート1289(01モル)をメタ 15 帯電防止効果の持続性を良好ならしめるため共重 ノール60㎖に溶解し、0.19のアゾピスイソブ チロニトリルを加え、60℃で2時間反応せしめ、 これをnーヘキサン中に注加して白色ガム状の共 重合体を得た。次いでこれをアセトンで洗滌し、 域圧乾燥して 2 9.7 **ま**を得た。得られた共重合体 20 剤、例えばメタノール中に溶解してプラスチツク の1%メタノール溶液の粘度は 1.5 7 C. P. であ つた。

H

N

合成例 2

例示化合物(4)の合成

とピリジン塩酸塩115.5分(1モル)とハイド ロキノン 0.1 まを 2 6 0 まのペンジルアルコール に溶解し、攪拌下に室温で8時間反応後エーテル を加え、沈殿した結晶を集め、アセトンで洗滌後 エチルアルコールにより再結晶して次の単量体

$$CH_3$$

$$CH_2 = C$$

$$COOCH_2 CHCH_2 - N$$

$$OH$$

185分を得た。

融点 165℃

Cl 元素分析 C H N 6.32 計算值 5 6.0 0 5.44 1 3.7 8 6.53 5.26 1 3.9 1 分析值 5 5.7 9

16

得られた単量体 2 5.7 9 (0.1 モル)、ラウリ ルアクリレート 24.08 (0.1モル)をメチルア ルコール60㎖とペンゼン20㎖の混合溶剤中に 溶解し、これに 0.1 9のアゾビスイソプチロニト COOCH₂ CHCH₂ N[⊕] (CH₃)₃ · Cl [⊖] 5 リルを加え遺流しながら65℃で24時間反応後 エーテル中に注加すると白色ガム状の共重合体を 得た。共重合体の1%メチルアルコール溶液の粘 度は 1.7 2 C. P. であつた。

> 本発明に係る他の共重合体の合成も上記の合成 10 例にならつてラジカル重合により合成することが できる。

本発明に用いられる共重合体の分子量は5000 ~200000、好ましくは10000~

50000であり、共重合モル比は水浸処理後の 合体に対して疎水性構造単位成分が10%以上で あり、好ましくは30%以上である。

このような共重合体を用いてプラスチツク材料 に帯電防止加工を施すには、共重合体を適当な密 材料の外面に塗設するか、複合プラスチツク材料 の場合は積層ブラスチック材料の中間層に設けて もよい。例えばハロゲン化銀写真感光材料の加工 時に、支持体フイルム上に帯電防止加工を施こし グリシジルメタクリレート1428(1モル) 25 この上に下引加工及びハロゲン化銀感光層を積層 加工することができる。また電子写真感光材料に おいて、支持体上に本発明の共重合体を用いて導 電加工を行いさらにこの上に光導電性組成物を積 屬して加工することができる。

> このような帯電防止層を設層するには、適用す るプラスチック材料の種類により相異するので特 に層の厚みは制限はないが一般に0.01μ~0.5 μ の厚みが好ましい。また本発明においてはプラス チック材料加工時に本発明の共重合体を混合含有 35 せしめ実質的に共重合体を含む層を有するように せしめてもよく、本発明においてはこのような実 施態様をも包含するものである。このように帯電 防止されたプラスチック材料の表面比抵抗は一般 に1012○以下であるが、特に感光層を積層した 40 複合プラスチック材料においては 1 0 ¹0Ω以下が 望ましく、本発明によれば所望の値とすることが

次に本発明の適用できるプラスチック材料とし ては、プラスチックフイルム、プラスチックシー

できる。

I7

ト、これらの上にハロゲン化銀写真感光層、ジア * **ゾ感光層もしくは電子写真感光層等を積層した感** 光材料、マツト層、ピール層もしくはスクライブ 層等を設層したグラフイツクアート用材料プラス チック成型品及び合成繊維等を包含するものであ 5 る。

次に本発明を実施例をあげて具体的に例証する が、これにより本発明の実施の態様が限定される ものではない。

実施例 1

例示化合物(1)、(2)及び(3)のそれぞれ 0.3 9をメ タノール30mlとアセトン30mlの混合溶剤にそ れぞれ溶解し、溶液の粘度がそれぞれ 1.0 8 C. P 、 1.1 7 C. P及び 1.2 0 C. Pの溶液を得 た。これらの溶液をトリアセテートフイルムに 15㎡/㎡の割合でそれぞれ塗布し、帯電防止加 工されたトリアセテートフイルムの3種類の試料 を得た。

又別に例示化合物の代りに、

CH₃ $\cdot + CH_2 - C \longrightarrow \frac{}{n}$ COOCH₂ CHCH₂N⊕(CH₃)₃ ·C1⊖ OH n = 100

18

10 で表わされる重合体を用いた他は試料と同様にし て比較試料を得た。

これらの試料及び比較試料を水、2%水酸化ナ トリウム水溶液及び 1.5%酢酸水溶液の 3種類の 処理液で25℃でそれぞれ5分間処理し、前記ア 15 ルカリ液及び酸液で処理したものはさらに水洗処 理してから室温で3時間乾燥し、25℃、相対虚 度55%に調盛調湿して試料の表面比抵抗を測定 して得られた値を第1表に示した。

第 1

	処理前表面 比抵抗 (Ω)	処理後の表面比抵抗 (Ω)			
化合物		水	アルカリ液	酸液	
例示化合物(1)	8 × 1 0 8	5 × 1 0 10	3×1010	2 × 1 0,11	
" (2)	8 × 1 0 8	8 × 1 0 10	5 × 1 0 10	4 × 1 0 11	
" (3)	8 × 1 0 8	2 × 1 0 11	1 × 1 0 11	2 × 1 0 12	
比較用重合体	8 × 1 0 8	1014以上	1014以上	1014以上	
無加工	1014以上	-			

第1表より明かなように本発明に係る例示化合 物(1)、(2)及び(3)を用いて設層されたトリアセテー おり、特に例示化合物(1)及び(2)が優れていること がわかる。

実施例 2

実施例1の試料及び比較試料の帯電防止加工さ で下引加工し、ハロゲン化銀高感度Xレイ乳剤を

塗布加工した。帯電防止加工面をゴム、ナイロン 及び不銹鋼で摩擦した後で現像処理して、スタチ トフイルムは優れた持続的帯電防止効果を示して 35 ツクマークの発生を調べた。さらに塵埃の付着の 度合を調べるため、実施例1の試料及び比較試料 を現像処理乾燥後25℃で相対湿度55%に調湿 した。次にゴム・ナイロン及び不銹鋼で摩擦帯電 せしめ、これを乾燥した煙草の灰の粉末に近接せ れたトリアセテートフイルムの裏面に通常の方法 40 しめ、この時附着する灰の粉末の量を測定(アツ シュテスト)した値を第2表に示した。

20

化 合 物	スタチックマーク		アツシュテスト			
	ゴム	ナイロン	不銹鋼	J 4	ナイロン	不銹鋼
例示化合物(1)	無	無	無	0	0	0
" (2)	無	無	無	0	0	· 0
" (3)	無	無	無	2	1	0 '
比較用重合体	無	無	無	50以上	50以上	5 0以上
無加工	強	強	弱	50以上	50以上	50以上

なおスタチツクマークの表示方法は無、弱及び強 *スチレン合成紙の試料を得た。次に例示化合物を の3段階で表示し、アツシユテストの表示方法は フイルムを煙草の灰から3㎝の距離に5秒間保持 15 した場合フイルム面上に附着した粉末の10cd当 りの個数で示した。

この表より本発明に係る例示化合物(1)、(2)及び (3)を用いて帯電防止加工されたハロゲン化銀写真 感光材料はスタチックマークテスト及びアッシユ 20 テストのいずれにも優れた帯電防止性能を示し、 特に(1)及び(2)が優れていることがわかる。

実施例 3

例示化合物(4)、(5)及び(6)のそれぞれ 0.5 9 をメ チルアルコール90mlとペンゼン10mlの混合溶 25 C.P.である重合体の溶液を用いた他は試料と同 剤に溶解して、粘度 1.28 C.P、1.20 C.P及 び1.17 C.P の3種類の溶液を得た。これらの 溶液を200 μ厚のポリスチレン合成紙に15 nl/nlの割合で塗布し、帯電防止加工されたポリ*

有機溶剤にとかした溶液の代りに、

$$+CH_2-CH \rightarrow n$$

で表わされる重合体0.59をメタノール90mlと ペンゼン10㎖の混合溶液にとかし粘度が108 様にして比較試料を得た。これらの試料及び比較 試料を用いて実施例1と同様にして表面比抵抗を 測定して得られた値を第3表に示した。

CH, COCH,

表

化合物	処理前表面 比抵抗 (Ω)	処理後の表面比抵抗 (Ω)			
		水	アルカリ液	酸液	
例示化合物(4)	2 × 1 0 8	1 × 1 0 10	1 × 1 0 10	7 × 1 0 10	
<i>"</i> (5)	2×10 ⁸	2 × 1 0 10	1 × 1 0 10	9 × 1 0 10	
″ (6)	7 × 1 0 8	2 × 1 0 10	5 × 1 0 10	1 × 1 0 2 3	
比較用重合体	1 × 1 0 ⁸	1014以上	1014以上	1014以上	
無加工	1014以上	_	_		

第3表より本発明に係る例示化合物(4)、(5)及び (6)を用いて帯電防止加工された合成紙は持続的帯

電防止効果が優れていることがわかる。 実施例 4

22

21

例示化合物(7、(8)及び(9)のそれぞれ 0.6 分をメ メ チルアルコール 7 0 ml とペンゼン 3 0 ml の混合溶 削に溶解して粘度が 1.1 8 C.P、 1.0 9 C.P. 及び 1.0 7 C.P の 3種類の溶液を得た。これらの溶液をエステルレジン 2 0 (東洋紡)を 0.7 μ 5 の厚さに設層した 1 0 0 μ厚のポリエチレンテレフタレートフイルムにそれぞれ 1 7 ml/π の割合で塗布して、帯電防止加工された 3 種類のポリエチレンテレフタレートフイルムの試料を得た。

別の例示化合物の代りに

CH₃

$$(CH_2 - C \xrightarrow{\cdot})_{n}$$

$$(CH_2 - C \xrightarrow{\cdot})_{n}$$

$$(COOCH_2 CH_2 N \oplus (C_2H_5)_2 \cdot C1 \oplus CH_2COCH_3$$

$$(CH_2COCH_3)$$

$$n = 1 0 0$$

で示される重合体を用いる他は試料と同様にして 比較試料を得た。これらの試料及び比較試料の無 加工のポリエチレンテレフタレートフイルムに対*

例示化合物(7)、(8)及び(9)のそれぞれ 0.6 gをメニ * する動摩擦係数(μg)及び静摩擦係数(μk) - ルアルコール 7 0 mlとペンゼン 3 0 mlの混合溶ニーの値を第 4 表に示した。

第 4 表

化合物	μ 8	# k
例示化合物(7)	0,40	0.34
" (8)	0.36	0.33
" (9)	0.31	0. 2 8
比較用重合体	0.62	0.5 2

第4表より本発明に係る疎水性構造単位を有する例示化合物(7)、(8)及び(9)を用いて帯電防止加工15 した表面の動及び静摩擦係数は疎水性構造単位を有しない比較用重合体を用いて帯電防止加工した表面より小さく、すべりがよいため、摩擦による傷の発生及び摩擦帯電をおとしにくいという利点を有することがわかる。

で さらに試料及び比較試料を用いて実施例1と同様にして表面比抵抗を測定して得られた値を第5表に示した。

第 5 表

化合物	処理前表面 比抵抗 (Ω)	処理後の表面比抵抗 (Ω)			
		水	アルカリ液	酸液	
例示化合物(7)	7 × 1 0 8	1 × 1 0 10	9 × 1 0 9	8 × 1 0 10	
" (8)	6 × 1 0 8	2 × 1 0 100	1 × 1 0 10	5 × 1 0 10	
" (9)	6 × 1 0 8	9 × 1 0 9	8 × 1 0 °	2 × 1 0 10	
比較用重合体	5 × 1 0 8	1014以上	1014以上	1014以上	

第 5 表より本発明に係る例示化合物(7)、(8)及び(9)を用いて帯電防止加工されたポリエチレンテレフタレートフイルムは明らかに優れた持続的帯電防止効果を示すことがわかる。

実施例 5

例示化合物(0)及び(1)のそれぞれ 0.5 **9**と 1/4 砂硝化綿 0.5 **9**をメチルアルコール 5 0 mlとエチ ルアルコール 3 0 mlとアセトン 2 0 mlの混合溶媒

に溶解して、粘度がそれぞれ1.82 C.P.及び1.71 C.P.の2種類の溶液を得た。これらの溶液をセルローズアセテートプチレートフイルムに15 ml/nlの割合で塗布して帯電防止加工された40 2種類のセルローズアセテートプチレートフイルムの試料を得た。

別に例示化合物の代りに

24

$$\begin{array}{c|c} + CH_2 - CH \xrightarrow{n} \\ | \\ COOCH_2CHN & S \cdot C_1 \xrightarrow{} n = 6 0 \\ | \\ CH & CH_3 & *5 \end{array}$$

*で示される重合体を用いる他は試料と同様にして 比較試料を得た。

試料及び比較試料の表面比抵抗を実施例1 に記載の方法で測定して得られる値を第6表に示した。

第 6 表

化合物	処理前表面	処理後の表面比抵抗 (Ω)		
10 79 100	比抵抗 (Ω)	水	アルカリ液	酸液
例示化合物00	2 × 1 0 9	8 × 1 0 10	8 × 1 0 10	5 × 1 0 11
// (11)	3 × 1 0 9	5 × 1 0 10	4 × 1 0 10	7 × 1 0 1 !
比較用重合体	2 × 1 0 9	8 × 1 0 18	7 × 1 0 13	1014以上